Family list 7 family members for: JP2001052868 Derived from 7 applications.

Back to JP2001052

- Organic electroluminescent element
  Publication info: CN1292022T T 2001-04-18
- 2 ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT Publication info: EP1061112 A1 - 2000-12-20
- 3 ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT Publication info: JP2001052868 A 2001-02-23
- 4 MATERIAL FOR ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT AND ELECTROLUMINESCENT ELEMENT USING THE SAME Publication info: JP2001131541 A 2001-05-15

cor L

Organic electroluminescent device Publication info: <u>US6743948 B1</u> - 2004-06-01

Organic electrolumescence device Publication info: US2003072966 A1 - 2003-04-17

7 ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT Publication info: WO0039247 A1 - 2000-07-06

Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

THIS PAGE BLANK (USPTO)

# ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

Patent number:

JP2001052868

**Publication date:** 

2001-02-23

Inventor:

HOSOKAWA CHISHIO; FUNAHASHI MASAKAZU: ARAI HIROMASA

Applicant:

**IDEMITSU KOSAN CO LTD** 

JP19990223056 19990805

Classification:

- international:

H05B33/14; C09K11/06; H05B33/10; H05B33/22

- european:

Application number:

•

Priority number(s):

#### Abstract of JP2001052868

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the light emitting efficiency and lifetime by including a specified quantity of the organic EL element material composed of a special compound as the center of the emission in a light emitting layer. SOLUTION: A light emitting layer includes 0.1-20 wt.% of an element material made of a compound expressed by formula I as the emission center. In formula I, A means a substituent or non-substituent allylene group having 6-21 carbon atoms, X1-X4 mean each a separate substituent or non-substituent allylene group having 6-30 carbon atoms (X1 and X2, X3 and X4 can be connected to each other), Y1-Y4 respectively means a group expressed with formula II, (a)-(d) is an integer 0-2; and (a)+(b)+(c)+(d)>0. In formula II, R1-R4 separately means a hydrogen atom, a substituent or non-substituent alkyl group and cyano group having 1-20 carbon atoms, or triple bond of R1 and R2, R3 and R4, and Z means a substituent or non-substituent aryl group having 6-20 carbon atoms, and (n) is 0 or 1.

Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

THIS PAGE BLANK (USPTO)

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(II)特許出額公開番号 特開2001-52868 (P2001-52868A)

(43)公開日 平成13年2月23日(2001.2.23)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テーマコード( <b>参考)</b>		
H05B 33/14		H05B 33/14	B 3K007		
CO9K 11/06	6 2 5	C 0 9 K 11/06	6 2 5		
H 0 5 B 33/10	•	H05B 33/10			
33/22		33/22	D		

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 27 頁)

	TEMPORAL MANAGEMENT OF (T. C. A)
特顏平11-223058	(71)出願人 000183646
平成11年8月5日(1999.85)	出光與産株式会社 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号
1 22 1 0 72 0 12 (1000.0.0)	(72)発明者 細川 地潮 千葉県袖ケ浦市上泉1280番地
	(72)発明者 舟橋 正和 千葉県袖ケ浦市上泉1280番地
	(72)発明者 新井 宏昌 千葉県袖ケ浦市上泉1280番地
	(74)代理人 100078732
	弁理士 大谷 保
	Fターム(参考) 3K007 AA00 AA03 AA06 CA01 CA06 CB01 DA00 DB03 EB00 FA01
	<b>特顧平11-223058</b> 平成11年8月5日(1999.8.5)

# (54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子

### (57)【要約】

(修正有)

【課題】 発光効率が高く、寿命が長い有機エレクトロルミネッセンス(EL)素子、有機EL素子用材料に使用可能な新規化合物及び有機素子用材料を高活性で製造する方法を提供する。

【解決手段】 一対の電極間に発光層または発光層を含む複数層の有機化合物薄膜を形成してなる有機EL素子において、該発光層が下記一般式〔1〕

$$(Y_i)^{c}X_i$$

$$(X_i)^{d}X_i$$

$$(X_i)^{d}X_i$$

$$(X_i)^{d}X_i$$

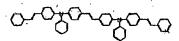
$$(X_i)^{d}X_i$$

$$(X_i)^{d}X_i$$

$$(Y_i)^{d}X_i$$

$$(Y_i$$

具体的には、例えば



で示される化合物からなる有機EL素子用材料を発光中心として0.  $1\sim20$ 重量%含有することを特徴とする有機EL素子。

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の電極間に発光層または発光層を含む複数層の有機化合物薄膜を形成してなる有機エレクトロルミネッセンス素子において、該発光層が下配一般式〔1〕で示される化合物からなる有機エレクトロルミネ\*

\* ッセンス素子用材料を発光中心として0.1~20重量 %含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセ ンス素子。

一般式〔1〕

[[1]]

$$\begin{pmatrix} Y^4 \xrightarrow{d} X^4 \\ N - A - N \\ X^2 \leftarrow Y^2 \end{pmatrix}_b$$
(1)

(式中、Aは置換もしくは未置換の炭素原子数6~21のアリーレン基を表す。 X¹~X¹は、それぞれ独立は、置換もしくは未置換の炭素原子数6~30のアリーレン基を表し、 X¹とX¹とX¹は互いに連結していてもよい。 Y¹~Y¹は、それぞれ独立に、下記一 ※

$$\begin{array}{c|c}
R^{1} R^{2} \\
C = C \\
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R^{2} R^{4} \\
C = C \\
\end{array}$$

※般式〔2〕で示される有機基を表す。a~dは0~2の 整数を表す。ただし、a+b+c+d>0である。 一般式〔2〕

【化2】

[2]

(式中、 $R^1 \sim R^1$  は、それぞれ独立に、水素原子、置換もしくは未置換の炭素原子数  $1\sim 20$ のアルキル基、置換もしくは未置換の炭素原子数  $6\sim 20$ のアリール基、シアノ基を表すか、 $R^1$  と  $R^1$  または  $R^1$  と  $R^1$  が結合した三重結合を表す。 Z は置換もしくは未置換の炭素原子数  $6\sim 20$  のアリール基を表す。 n は 0 もしくは 1 を表す。 ) ]

【請求項2】 一対の電極間に発光層または発光層を含む複数層の有機化合物薄膜を形成してなる有機エレクトロルミネッセンス素子において、正孔注入材料、正孔輸 30 送材料又は電子輸送材料の中から選ばれる少なくとも一種類の材料に、請求項1に記載の一般式〔1〕で示される有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を、それぞれ独立に0.1~20重置%含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項3】 一対の電極間に発光層または発光層を含む複数層の有機化合物薄膜を形成してなる有機エレクトロルミネッセンス素子において、該発光層がスチルベン誘導体及び請求項1に記載の一般式〔1〕で示される有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を含有する層で 40 あることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素★

★子。

【請求項4】 芳香族三級アミン誘導体および/またはフタロシアニン誘導体を含有する層を、発光層と陽極との間に形成してなることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。 【請求項5】 前記一般式〔1〕の式中Aが、下記一般式〔3〕又は〔4〕で示される基であることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

一般式〔3〕

【化3】

一般式〔4〕 【化4】

(式中、R'~R'は、それぞれ独立に、水素原子、置換もしくは未置換の炭素原子数1~20のアルキル基、

置換もしくは未置換の炭素原子数6~20のアリール基 50 又はシアノ基を表し、隣接するものが互いに結合し、飽

和又は不飽和の炭素環を形成していても良い。) 【請求項6】 前記一般式〔1〕の式中Aが、下記一般 式〔5〕で示される基であるととを特徴とする請求項1 ~5のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス 素子。

# 一般式〔5〕

[化5]

〔式中、Aは下記一般式〔5〕で示される基を表す。X 1~X1は、それぞれ独立に、置換もしくは未置換の炭 素原子数6~30のアリーレン基を表し、X'とX'、 X³ とX' は互いに連結していてもよい。Y¹ ~Y 1は、それぞれ独立に、下記一般式 [2] で示される有 機基を表す。a~dは0~2の整数を表す。ただし、a +b+c+d>0である。

#### 一般式〔5〕

[{t7]

(式中、R¹~R¹は、それぞれ独立に、水素原子、置 換もしくは未置換の炭素原子数1~20のアルキル基、 置換もしくは未置換の炭素原子数6~20のアリール 基、シアノ基を表すか、R¹とR゚またはR゚とR゚が~ 結合した三重結合を表す。Zは置換もしくは未置換の炭 素原子数6~20のアリール基を表す。nは0もしくは 1を表す。))

【請求項9】 ホスフィン化合物とハラジウム化合物か 50

\* (式中、R''~R''は、それぞれ独立に、水素原子、置 換もしくは未置換の炭素原子数1~20のアルキル基、 置換もしくは未置換の炭素原子数6~20のアリール 基、シアノ基を表し、隣接するものが互いに結合し、飽 和又は不飽和の炭素環を形成していても良い。) 【請求項7】 前記一般式〔1〕で示される有機エレク トロルミネッセンス素子用材料のエネルギーギャップ が、ホスト材料のエネルギーギャップより0.07eV 以上小さいことを特徴とする請求項1~6のいずれかに 記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。 【請求項8】 下配一般式〔1'〕で示される新規化合

一般式〔1′〕 [化6]

[1']

※(式中、R\*\*\*~R\*\*は、それぞれ独立に、水素原子、置 換もしくは未置換の炭素原子数1~20のアルキル基、 置換もしくは未置換の炭素原子数6~20のアリール 基、シアノ基を表し、隣接するものが互いに結合し、飽 和又は不飽和の炭素環を形成していても良い。) 一般式〔2〕

[(18]

(2)

らなる触媒及び塩基の存在下で、下記一般式 [6] R(NR'H), (6) (式中、kは1~3の整数を表し、kが1のときR及び R'は水素原子、アルキル基、置換もしくは無置換のア リール基を表し、kが2以上のときRはアルキレン基又

は置換もしくは無置換のアリーレン基、R'は水素原 子、アルキル基、置換もしくは無置換のアリール基を表

す。)で示される1級又は2級アミンと、下記一般式

Ar(X)(7)

(式中、Arは置換又は無置換のアリール基を表し、X はF、C1、Br又は1を表し、mは1~3の整数を表 す。ただし、R、R'及びArのうち少なくとも一種類 はスチリル基を含有し、kが2のときはNに置換する R'は異なっていても良い。)で示されるアリールハラ米 \* イドとを反応させ、アリールアミン化合物からなる有機 素子用材料を製造することを特徴とする有機素子用材料 の製造方法。

【請求項10】 前記アリールアミン化合物が、下記式 〔8〕で示される化合物であることを特徴とする請求項 9に記載の有機素子用材料の製造方法。一般式〔8〕 [{tb9]

$$(X_{1})^{-1}X_{1}$$

$$(X_{1})^{-1}X_{1}$$

$$(X_{1})^{-1}X_{1}$$

$$(X_{1})^{-1}X_{1}$$

$$(X_{2})^{-1}X_{1}$$

$$(X_{3})^{-1}X_{1}$$

$$(X_{1})^{-1}X_{1}$$

$$(X_{2})^{-1}X_{2}$$

〔式中、Aは置換もしくは未置換の炭素原子数6~60 のアリーレン基を表す。X'~X'は、それぞれ独立 に、置換もしくは未置換の炭素原子数6~30のアリー レン基を表し、X'とX'、X'とX'は互いに連結し ていてもよい。 Y'~Y'は、それぞれ独立に、下記一 ※

$$\begin{pmatrix}
R^{1} & R^{2} \\
 & | & | \\
 & C = C
\end{pmatrix}
\qquad
\begin{pmatrix}
R^{3} & R^{4} \\
 & | & | \\
 & C = C
\end{pmatrix}$$

(式中、R1 ~R1 は、それぞれ独立に、水素原子、置 換もしくは未置換の炭素原子数1~20のアルキル基、 置換もしくは未置換の炭素原子数6~20のアリール 基、シアノ基を表すか、R'とR'またはR'とR'が 結合した三重結合を表す。乙は置換もしくは未置換の炭 素原子数6~20のアリール基を表す。 n は0 もしくは 1を表す。))

【請求項11】 前記ホスフィン化合物が、トリアルキ ルホスフィン化合物、トリアリールホスフィン化合物又 30 はジホスフィン化合物であることを特徴とする請求項9 に記載の有機素子用材料の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は壁掛テレビの平面発 光体やディスプレイのバックライト等の光源として使用 され、発光効率が高く、寿命が長い有機エレクトロルミ ネッセンス素子、有機素子用材料の製造方法及び新規化 合物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】有機物質を使用した有機エレクトロルミ ネッセンス(EL)素子は、固体発光型の安価な大面積 フルカラー表示素子としての用途が有望視され、多くの 開発が行われている。一般にEL素子は、発光層および 該層をはさんだ一対の対向電極から構成されている。発 光は、両電極間に電界が印加されると、陰極側から電子 が注入され、陽極側から正孔が注入される。さらに、と の電子が発光層において正孔と再結合し、励起状態を生 成し、励起状態が基底状態に戻る際にエネルギーを光と して放出する現象である。従来の有機EL素子は、無機 50 われてきた。例えば、Chem.Lett..pp.1

※般式〔2〕で示される有機基を表す。 a~dは0~2の 整数を表す。ただし、a+b+c+d>0である。 一般式[2]

【化10】

(2)

発光ダイオードに比べて駆動電圧が高く、発光輝度や発 光効率も低かった。また、特性劣化も著しく実用化には 至っていなかった。最近の有機EL素子は徐々に改良さ れているものの、未だ充分な発光効率、耐熱性、寿命を 有していなかった。例えば、特開平8-12600 号公報には EL素子に使用できるフェニルアントラセン誘導体が開 示されているが、この化合物を利用した有機EL素子は 発光効率が2~4cd/A程度しかなく、より高い効率 が求められていた。特開平8-199162号公報には、発光層 にアミンまたはジアミン誘導体からなる蛍光性ドーバン トを含有するEL素子が開示されている。しかしなが ら、このEL素子は発光効率が4~6cd/Aであるも のの、寿命が初期輝度300cd/m²で700時間し かなく、より長寿命が求められていた。特開平9-268284 号公報にはフェニルアントラセン基を有するEL素子用 材料が開示されているが、この材料をホスト材料とし、 他の化合物をドーピング材料として使用すると長寿命が 得られなかった。実用的には初期輝度10000cd/ 40 m'以上が求められているが得られていない。特開平11 -152253 号公報には、ビナフタレン構造を有する有機E L素子用材料を、A 1 錯体等の電子輸送性の発光層に添 加した例が開示されている。しかしながら、この例で は、AI錯体等の発光層のエネルギーギャップが有機E L素子用材料のエネルギーギャップより小さいため、A 1 錯体等が発光して該有機 E L 素子用材料は発光中心と して機能しなかった。一方、有機EL素子用材料となる アリールアミン類の合成は、従来、アミンとヨウ化ベン ゼン類を用いウルマン(U11mann)反応により行

145~1148, 1989、米国特許第4, 764, 625号明細書、特開平8-48974号公報等には、1当量 以上の銅粉及び水酸化カリウムに代表される塩基の存在 下でデカリン等の不活性炭化水素溶媒中150℃以上で 対応するヨウ化ベンゼン類とジアリールアミンとを反応 させトリアリールアミンを製造することが記載されてい る。しかしながら、ウルマン反応による方法では、反応 剤として高価なヨウ化物を用いなければならず、応用性 も乏しく、反応収率も充分ではなかった。また150°C 以上の髙温と長い反応時間を要し、銅粉を大量に使用す 10 るため、大量の銅を含む廃液が生じ、環境上の問題もあ った。

#### [000:3]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、前記の課題 を解決するためになされたもので、発光効率が高く、寿 命が長い有機エレクトロルミネッセンス素子、有機エレ クトロルミネッセンス素子用材料に使用可能な新規化合 物及び有機素子用材料を高活性で製造する方法を提供す ることを目的とするものである。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記の好\*

[(1:11] (1)

〔式中、Aは置換もしくは未置換の炭素原子数6~21 のアリーレン基を表す。X¹~X¹は、それぞれ独立 に、置換もしくは未置換の炭素原子数6~30のアリー 30 一般式[2] レン基を表し、X'とX'、X'とX'は互いに連結し ていてもよい。Y'~Y'は、それぞれ独立に、下記一※

$$\begin{pmatrix}
R^1 & R^2 \\
 & | & | \\
C & = C
\end{pmatrix}
\qquad
\begin{pmatrix}
R^3 & R^4 \\
 & | & | \\
 & C & = C
\end{pmatrix}$$

(式中、R'~R'は、それぞれ独立に、水素原子、置 換もしくは未置換の炭素原子数1~20のアルキル基 置換もしくは未置換の炭素原子数6~20のアリール 基、シアノ基を表すか、R'とR'またはR'とR'が 40 結合した三重結合を表す。Zは置換もしくは未置換の炭 素原子数6~20のアリール基を表す。nは0もしくは ...1を表す。))

【0006】本発明の有機EL素子は、一対の電極間に 発光層または発光層を含む複数層の有機化合物薄膜を形 成してなる有機エレクトロルミネッセンス素子におい て、正孔注入材料、正孔輸送材料又は電子輸送材料の中 から選ばれる少なくとも一種類の材料に、上記一般式 〔1〕で示される有機EL素子用材料を、それぞれ独立 に0.1~20重量%含有する有機EL素子であっても 50

\*ましい性質を有する有機エレクトロルミネッセンス素子 (以下、有機EL累子) 及び有機エレクトロルミネッセ ンス索子用材料(以下、有機EL索子用材料)を開発す べく鋭意研究を重ねた結果、下記一般式〔1〕又は 〔1′〕で示される化合物をドービング材料又は発光中 心として利用することによりその目的を達成し得ること を見出した。さらに、本発明者らは、ホスフィン化合物 とバラジウム化合物からなる触媒及び塩基の存在下で、 アミンとアリールハライドを反応させることにより、3 級アリールアミン類の有機EL素子用材料を高活性に合 成できることを見出した。本発明は、かかる知見に基づ

【0005】すなわち、本発明の有機EL素子は、一対 の電極間に発光層または発光層を含む複数層の有機化合 物薄膜を形成してなる有機EL素子において、該発光層 が下記一般式〔1〕で示される化合物からなる有機EL 素子用材料を発光中心として0.1~20重量%含有す ることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素 子。

20 一般式〔1〕

いて完成したものである。

※般式〔2〕で示される有機基を表す。 $a \sim d t = 0$ 整数を表す。ただし、a+b+c+d>0である。

[(1:12]

良く、該発光層がスチルベン誘導体及び上記一般式 〔1〕で示される有機EL素子用材料を含有する層であ る有機EL素子であっても良い。

(2)

【0007】本発明の有機EL素子は、芳香族三級アミ ン誘導体および/またはフタロシアニン誘導体を含有す る層を、発光層と陽極との間に形成してなる有機EL素 子であっても良い。

【0008】前記一般式 [1] の式中Aは、下記一般式 〔3〕、〔4〕又は〔5〕で示される基であることが好 ましい。

【0009】一般式〔3〕 【化13】

\*【0010】一般式〔4〕 [(614]

【0011】一般式〔5〕 【化15】

(式中、R'~R'は、それぞれ独立に、水素原子、置 換もしくは未置換の炭素原子数1~20のアルキル基、※

※置換もしくは未置換の炭素原子数6~20のアリール基 又はシアノ基を表し、隣接するものが互いに結合し、飽 和又は不飽和の炭素環を形成していても良い。) 【0012】前記一般式[1]で示される有機EL素子 用材料のエネルギーギャップが、ホスト材料のエネルギ 20 ーギャップより 0.07 e V以上小さいことが好まし く、0.15eV以上小さいとさらに好ましい。 【0013】また、本発明は下記一般式〔1'〕の式中 Aが、上記一般式〔5〕である新規化合物を提供するも のである。

一般式〔1′〕

[化16]

〔式中、Aは上記一般式〔5〕で示される基を表す。X 1 ~X は、それぞれ独立に、置換もしくは未置換の炭 素原子数6~30のアリーレン基を表し、X'とX'、 X'とX'は互いに連結していてもよい。Y'~Y 'は、それぞれ独立に、上記一般式〔2〕で示される有 機基を表す。a~dは0~2の整数を表す。ただし、a 

【0014】さらに、本発明の有機EL素子用材料の製 40 造方法は、ホスフィン化合物とバラジウム化合物からな る触媒及び塩基の存在下で、下記一般式〔6〕

R(NR'H). (6)

(式中、kは1~3の整数を表し、kが1のときR及び R' は水素原子、アルキル基、置換もしくは無置換のア リール基を表し、kが2以上のときRはアルキレン基又 は置換もしくは無置換のアリーレン基、R'は水素原

子、アルキル基、置換もしくは無置換のアリール基を表 す。)で示される1級又は2級アミンと、下記一般式 (7)

Ar (X),

(式中、Arは置換又は無置換のアリール基を表し、X はF、C1、Br又は1を表し、mは1~3の整数を表 す。ただし、R、R'及びArのうち少なくとも一種類 はスチリル基を含有し、kが2のときはNに置換する R'は異なっていても良い。)で示されるアリールハラ イドとを反応させ、アリールアミン化合物からなる有機 素子用材料を製造する方法である。

【0015】前記アリールアミン化合物は、下記式 [8] で示される化合物であることが好ましい。 一般式 [8] 【化17】

〔式中、Aは置換もしくは未置換の炭素原子数6~60 のアリーレン基を表す。X'~X'は、それぞれ独立 に、置換もしくは未置換の炭素原子数6~30のアリー ていてもよい。Y'~Y'は、それぞれ独立に、上記一 般式〔2〕で示される有機基を表す。 a~dは0~2の 整数を表す。ただし、a+b+c+d>0である。] 前記ホスフィン化合物が、トリアルキルホスフィン化合 物、トリアリルホスフィン化合物又はジホスフィン化合 物であるととが好ましい。

#### [0016].

【発明の実施の形態】本発明の有機EL素子で使用する 材料及び新規化合物における一般式〔1〕及び〔1'〕 子数6~21のアリーレン基を表し、具体例としてピフ ェニル、ターフェニル、ナフタレン、アントラセン、フ ェナントレン、ピレン、フルオレン、チオフェン、フル オランテンなどから形成されるか又は2価の基などが挙 げられる。また一般式〔1〕で示される化合物のX1~ X'は、それぞれ独立に、置換もしくは未置換の炭素原 子数6~30のアリーレン基を表し、具体例としてフェ ニレン、ピフェニル、ターフェニル、ナフタレン、アン トラセン、フェナントレン、ピレン、フルオレン、チオ フェン、コロネン、クリセン骨格を含有する1価又は2 価の基が挙げられる。また、X¹とX¹、X¹とX¹は 互いに連結していてもよい。一般式〔1〕及び〔1'〕 において、a~dは0~2の整数を表す。ただし、a+ b+c+d>0である。

【0017】本発明における一般式〔2〕で示される有 機基のR¹~R¹は、それぞれ独立に、水素原子、置換 もしくは未置換の炭素原子数1~20のアルキル基、置 換もしくは未置換の炭素原子数6~20のアリール基も しくはシアノ基を表す。R1~R1の具体例は、置換も しくは未置換のアルキル基としては、メチル基、エチル 基、プロピル基、ブチル基、sec-ブチル基、ter オープチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、 オクチル基、ステアリル基、2-フェニルイソプロビル 基、トリクロロメチル基、トリフルオロメチル基、ベン ジル基、α-フェノキシベンジル基、α, α-ジメチル ベンジル基、 $\alpha$ ,  $\alpha$ -メチルフェニルベンジル基、 $\alpha$ , α-ジトリフルオロメチルベンジル基、トリフェニルメ チル基、αーベンジルオキシベンジル基等がある。置換 もしくは未置換のアリール基としては、フェニル基、2 ーメチルフェニル基、3 ーメチルフェニル基、4 ーメチ 50 チルベンジル基、トリフェニルメチル基、α ーベンジル

ルフェニル基、4-エチルフェニル基、ピフェニル基、 4-メチルピフェニル基、4-エチルピフェニル基、4 -シクロヘキシルピフェニル基、ターフェニル基、3、 レン基を表し、X'とX'、X'とX'は互いに連結し 10 5-ジクロロフェニル基、ナフチル基、5-メチルナフ チル基、アントリル基、ビレニル基等が挙げられる。 【0018】本発明における一般式〔2〕で示される有 機基の2は、それぞれ独立に置換もしくは未置換の炭素 原子数6~20のアリール基を表す。2の具体例は、フ ェニル基、ピフェニル基、ターフェニル基、ナフチル 基、アントリル基、フェナントリル基、フルオレニル 基、ビレニル基、チオフェン基、フェニルエテニル基、 ジフェニルエテニル基、トリフェニルエテニル基等のア リール基であり、上記アリール基は置換基を有していて で示される化合物のAは、置換もしくは未置換の炭素原 20 も良い。置換基の具体例は、Rº ~Rº で記述したアル キル基およびアリール基に加えて、アルコキシ基、アミ ノ基、シアノ基、水酸基、カルボン酸基、エーテル基、 エステル基等がある。一般式[2]のnは0もしくは1 を表す。このように、本発明における一般式 [1] 及び 〔1'〕で示される化合物は、中心にシアミン構造を有 し末端にスチリルアミン構造を有するととにより、イオ ン化エネルギーが5.6 e V以下となり、発光層中に添 加されることにより発光層への正孔注入性を向上させる と共に、正孔捕捉することによで発光層での電子と正孔 30 のパランス(量比)を改善し、発光効率及び寿命が改善 される。単一の有機EL素子用材料として上記化合物 〔1〕又は〔1′〕を単独で発光層として用いた場合に 比べ、発光効率及び寿命が改善される。尚、X'と X'、X'とX'が単結合又は炭素環結合などで連結し た化合物は、ガラス転移温度が向上し耐熱性が優れる。 【0019】本発明における一般式[3]~(5)で示 される基におけるR'~R'は、それぞれ独立に、水素 原子、置換もしくは未置換の炭素原子数1~20のアル キル基、置換もしくは未置換の炭素原子数6~20のア リール基又はシアノ基を表し、隣接するものが互いに結 合し、飽和又は不飽和の炭素環を形成していても良い。 R'~R'の具体例は、置換もしくは未置換のアルキル 基としては、メチル基、エチル基、プロビル基、プチル 基、Sec‐ブチル基、tert‐ブチル基、ペンチル 基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ステアリル 基、2-フェニルイソプロピル基、トリクロロメチル 基、トリフルオロメチル基、ベンジル基、αーフェノキ シベンジル基、 $\alpha$ 、 $\alpha$  - ジメチルベンジル基、 $\alpha$ ,  $\alpha$  -メチルフェニルベンジル基、α、α-ジトリフルオロメ

オキシベンジル基等がある。置換もしくは未置換のアリール基としては、フェニル基、2-メチルフェニル基、4-エ チルフェニル基、ピフェニル基、4-メチルピフェニル基、4-エチルピフェニル基、4-エチルピフェニル基、4-エチルピフェニル基、3.5-ジクロロフェニル基、ナフチル基、5-メチルナフチル基、アントリル \*

\*基、ピレニル基等が挙げられる。 【0020】以下に、本発明の一般式〔1〕及び 〔1'〕の化合物の代表例(1)~(15)を例示する が、本発明はこの代表例に限定されるものではない。 【0021】 【化18】

$$\begin{array}{c} C = C \\ C = C \\$$

化合物 b

(4)

$$M \circ - \bigcirc - C = C - \bigcirc - N - \bigcirc - \bigcirc - N - \bigcirc - C = C - \bigcirc - M \circ$$

[0022]

【化19】

(5)

[0023]

[化20]

(14)

化合物 a

[0024]

化合物 f

【0025】本発明の有機EL素子は、陽極と陰極間に 一層もしくは多層の有機薄膜を形成した素子である。一 層型の場合、陽極と陰極との間に発光層を設けている。 発光層は、発光材料を含有し、それに加えて陽極から注 入した正孔、もしくは陰極から注入した電子を発光材料 まで輸送させるために、正孔注入材料もしくは電子注入 材料を含有しても良い。しかしながら、発光材料は、極 めて高い蛍光量子効率、高い正孔輸送能力および電子輸 送能力を併せ持ち、均一な薄膜を形成することが好まし い。多層型の有機EL素子は、(陽極/正孔注入層/発 50 発光材料、ドーピング材料、正孔注入材料や電子注入材

光層/陰極)、(陽極/発光層/電子注入層/陰極)、 (陽極/正孔注入層/発光層/電子注入層/陰極)の多 層構成で積層したものがある。一般式〔1〕、〔1'〕 及び〔8〕の化合物は、高い発光特性を持ち、優れた正 孔注入性、正孔捕捉性を有しているので、発光中心とし て0.1~20重量%添加して発光層に使用することが できる。

【0026】発光層には、必要に応じて、本発明の一般 式〔1〕又は〔1'〕の化合物に加えてさらなる公知の 料を使用することもできる。有機EL索子は、多層構造 にすることにより、クエンチングによる輝度や寿命の低 下を防ぐことができる。必要があれば、発光材料、他の ドーピング材料、正孔注入材料や電子注入材料を組み合 わせて使用することができる。また、他のドーピング材 料により、発光輝度や発光効率の向上、赤色や白色の発 光を得ることもできる。また、正孔注入層、発光層、電 子注入層は、それぞれ二層以上の層構成により形成され ても良い。その際には、正孔注入層の場合、電極から正 孔を注入する層を正孔注入層、正孔注入層から正孔を受 10 け取り発光層まで正孔を輸送する層を正孔輸送層と呼 ぶ。同様に、電子注入層の場合、電極から電子を注入す る層を電子注入層、電子注入層から電子を受け取り発光 層まで電子を輸送する層を電子輸送層と呼ぶ。これらの 各層は、材料のエネルギー準位、耐熱性、有機層もしく は金属電極との密着性等の各要因により選択されて使用 される。

【0027】一般式〔1〕又は〔1′〕の化合物と共に 発光層に使用できる発光材料またはホスト材料として ン、テトラセン、コロネン、クリセン、フルオレセイ ン、ペリレン、フタロペリレン、ナフタロペリレン、ペ リノン、フタロペリノン、ナフタロペリノン、ジフェニ ルブタジエン、テトラフェニルブタジエン、クマリン、 オキサジアゾール、アルダジン、ピスペンゾキサゾリ ン、ビススチリル、ビラジン、シクロベンタジェン、キ ノリン金属錯体、アミノキノリン金属錯体、ベンゾキノ リン金属錯体、イミン(ジフェニルエチレン、ピニルア ントラセン、ジアミノカルバゾール、ピラン、チオピラ ン、ポリメチン、メロシアニン、イミダゾールキレート 30 化オキシノイド化合物、キナクリドン、ルブレン、スチ ルベン系誘導体及び蛍光色素等が挙げられるが、これら に限定されるものではない。尚、発光層におけるホスト 材料の含有量は、一般式〔1〕又は〔1〕」の化合物よ り多いことが必須であり、好ましくは80~99.9重 量%である。

【0028】正孔注入材料としては、正孔を輸送する能 力を持ち、陽極からの正孔注入効果、発光層または発光 材料に対して優れた正孔注入効果を有し、発光層で生成 した励起子の電子注入層または電子注入材料への移動を 防止し、かつ薄膜形成能力の優れた化合物が好ましい。 具体的には、フタロシアニン誘導体、ナフタロシアニン 誘導体、ポルフィリン誘導体、オキサゾール、オキサジ アゾール、トリアゾール、イミダゾール、イミダゾロ ン、イミダゾールチオン、ビラゾリン、ビラゾロン、テ トラヒドロイミダゾール、オキサゾール、オキサジアゾー ール、ヒドラゾン、アシルヒドラゾン、ポリアリールア ルカン、スチルベン、ブタジエン、ベンジジン型トリフ ェニルアミン、スチリルアミン型トリフェニルアミン、 ジアミン型トリフェニルアミン等と、それらの誘導体、

およびポリビニルカルパゾール、ポリシラン、導電性高 分子等の高分子材料が挙げられるが、これらに限定され るものではない。

【0029】本発明の有機EL素子において使用できる 正孔注入材料の中で、さらに効果的な正孔注入材料は、 芳香族三級アミン誘導体もしくはフタロシアニン誘導体 である。芳香族三級アミン誘導体の具体例は、トリフェ ニルアミン、トリトリルアミン、トリルジフェニルアミ ン、N, N' -ジフェニル-N, N' - (3-メチルフ ェニル) -1, 1' -ピフェニル-4, 4' -ジアミ ン、N, N, N', N'-(4-メチルフェニル)-1, 1'-フェニル-4, 4'-ジアミン、N, N, ェニルー4, 4'ージアミン、N, N'ージフェニルー N, N' -ジナフチル-1, 1' -ピフェニル-4, 4'-ジアミン、N. N'-(メチルフェニル)-N. 9, 10-ジアミン、N, N-ビス (4-ジ-4-トリ ルアミノフェニル)-4-フェニル-シクロヘキサン は、アントラセン、ナフタレン、フェナントレン、ピレ 20 等、もしくはとれらの芳香族三級アミン骨格を有したオ リゴマーもしくはポリマーであるが、これらに限定され るものではない。フタロシアニン (Pc) 誘導体の具体 例は、H, Pc、CuPc、CoPc、NiPc、Zn Pc, PdPc, FePc, MnPc, ClAlPc, ClGaPc, ClInPc, ClSnPc, Cl, S iPc, (HO) AlPc, (HO) GaPc, VOP c, TiOPc, MoOPc, GaPc-O-GaPc 等のフタロシアニン誘導体およびナフタロシアニン誘導 体でがあるが、これらに限定されるものではない。

【0030】電子注入材料としては、電子を輸送する能 力を持ち、陰極からの電子注入効果、発光層または発光 材料に対して優れた電子注入効果を有し、発光層で生成 した励起子の正孔注入層への移動を防止し、かつ薄膜形 成能力の優れた化合物が好ましい。具体的には、フルオ レノン、アントラキノジメタン、ジフェノキノン、チオ ビランジオキシド、オキサゾール、オキサジアゾール、 トリアゾール、イミダゾール、ベリレンテトラカルボン 酸、フレオレニリデンメタン、アントラキノジメタン、 アントロン等とそれらの誘導体が挙げられるが、これら に限定されるものではない。また、正孔注入材料に電子 受容物質を、電子注入材料に電子供与性物質を添加する ことにより電子注入性を向上させることもできる。

【0031】本発明の有機EL素子において、さらに効 果的な電子注入材料は、金属錯体化合物もしくは含窒素 五員環誘導体である。金属錯体化合物の具体例は、8-ヒドロキシキノリナートリチウム、ビス(8-ヒドロキ シキノリナート) 亜鉛、ビス (8-ヒドロキシキノリナ ート) 銅、ビス(8-ヒドロキシキノリナート) マンガ ン、トリス(8-ヒドロキシキノリナート) アルミニウ 50 ム、トリス(2-メチル-8-ヒドロキシキノリナー

ト)アルミニウム、トリス(8-ヒドロキシキノリナート)ガリウム、ビス(10-ヒドロキシベンゾ[h]キノリナート)ベリリウム、ビス(10-ヒドロキシベンゾ[h]キノリナート)でリウム、ビス(2-メチル-8-キノリナート)クロロガリウム、ビス(2-メチル-8-キノリナート)(0-クレゾラート)ガリウム、ビス(2-メチル-8-キノリナート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリナート)(2-ナフトラート)ガリウム等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0032】また、含窒素五員誘導体は、オキサゾー ル、チアゾール、オキサジアゾール、チアジアゾールも しくはトリアゾール誘導体が好ましい。具体的には、 2, 5-ビス(1-フェニル)-1, 3, 4-オキサゾ ール、ジメチルPOPOP、2, 5~ビス (1-フェニ ル) -1, 3, 4-チアゾール、2, 5-ビス (1-フ ェニル) -1, 3, 4-オキサジアゾール、2-(4' -tert-プチルフェニル) -5-(4"-ピフェニ ル) 1, 3, 4-オキサジアゾール、2, 5-ビス(1 ーナフチル) - 1, 3, 4 - オキサジアゾール、1, 4 20 ービス [2-(5-フェニルオキサジアゾリル)]ベン ゼン、1、4ービス[2-(5-フェニルオキサジアソ リル) -4-tert-プチルベンゼン]、2-(4' -tert-ブチルフェニル) -5-(4"-ピフェニ (1, 0) -1, 3, 4-チアジアゾール、2, 5-ビス(1) ーナフチル) - 1, 3, 4 - チアジアゾール、1, 4 -ピス [2-(5-フェニルチアジアゾリル)] ベンゼ ン、2-(4'-tert-ブチルフェニル)-5-(4" ーピフェニル) -1, 3, 4ートリアゾール、2, 5ービス(1ーナフチル)-1,3,4ートリアゾー ル、1, 4-ビス[2-(5-)ェニルトリアゾリル) 」ベンゼン等が挙げられるが、これらに限定されるも のではない。

【0033】本発明の有機EL素子においては、発光層中に、一般式〔1〕又は〔1'〕の化合物の他に、発光材料、ドービング材料、正孔注入材料および電子注入材料の少なくとも1種が同一層に含有されてもよい。また、本発明により得られた有機EL素子の、温度、湿度、雰囲気等に対する安定性の向上のために、素子の表面に保護層を設けたり、シリコンオイル、樹脂等により素子全体を保護することも可能である。

【0034】有機EL素子の陽極に使用される導電性材料としては、4eVより大きな仕事関数を持つものが適しており、炭素、アルミニウム、バナジウム、鉄、コバルト、ニッケル、タングステン、銀、金、白金、バラジウム等およびそれらの合金、ITO基板、NESA基板に使用される酸化スズ、酸化インジウム等の酸化金属、さらにはポリチオフェンやポリピロール等の有機導電性樹脂が用いられる。陰極に使用される導電性物質としては、4eVより小さな仕事関数を持つものが適してお

り、マグネシウム、カルシウム、錫、鉛、チタニウム、イットリウム、リチウム、ルテニウム、マンガン、アルミニウム等およびそれらの合金が用いられるが、とれらに限定されるものではない。合金としては、マグネシウム/銀、マグネシウム/インジウム、リチウム/アルミニウム等が代表例として挙げられるが、これらに限定されるものではない。合金の比率は、蒸着源の温度、雰囲気、真空度等により制御され、適切な比率に選択される。陽極および陰極は、必要があれば二層以上の層構成10により形成されていても良い。

【0035】有機EL素子では、効率良く発光させるた めに、少なくとも一方の面は素子の発光波長領域におい て充分透明にすることが望ましい。また、基板も透明で あることが望ましい。透明電極は、上記の導電性材料を 使用して、蒸着やスパッタリング等の方法で所定の透光 性が確保するように設定する。発光面の電極は、光透過 率を10%以上にすることが望ましい。基板は、機械 的、熱的強度を有し、透明性を有するものであれば限定 されるものではないが、ガラス基板および透明性樹脂フ ィルムがある。透明性樹脂フィルムとしては、ポリエチ レン、エチレン-酢酸ビニル共重合体、エチレン-ビニ ルアルコール共重合体、ポリプロビレン、ポリスチレ ン、ポリメチルメタアクリレート、ポリ塩化ビニル、ポ リビニルアルコール、ポリビニルブチラール、ナイロ ン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリサルホン、ポリ エーテルサルフォン、テトラフルオロエチレンーパーフ ルオロアルキルビニルエーテル共重合体、ポリビニルフ ルオライド、テトラフルオロエチレンーエチレン共重合 体、テトラフルオロエチレンーヘキサフルオロプロビレ 30 ン共重合体、ポリクロロトリフルオロエチレン、ポリビ ニリデンフルオライド、ポリエステル、ポリカーボネー ト、ポリウレタン、ポリイミド、ポリエーテルイミド、 ポリイミド、ポリプロピレン等が挙げられる。

【0036】本発明に係わる有機EL素子の各層の形成は、真空蒸着、スパッタリング、ブラズマ、イオンプレーティング等の乾式成膜法やスピンコーティング、ディッピング、フローコーティング等の湿式成膜法のいずれの方法を適用することができる。膜厚は特に限定されるものではないが、適切な膜厚に設定する必要がある。膜40 厚が厚すぎると、一定の光出力を得るために大きな印加電圧が必要になり効率が悪くなる。膜厚が薄すぎるとピンホール等が発生して、電界を印加しても充分な発光輝度が得られない。通常の膜厚は5nmから10μmの範囲が適しているが、10nmから0.2μmの範囲がさらに好ましい。

【0037】湿式成膜法の場合、各層を形成する材料を、エタノール、クロロホルム、テトラヒドロフラン、ジオキサン等の適切な溶媒に溶解または分散させて薄膜を形成するが、その溶媒はいずれであっても良い。また、いずれの有機薄膜層においても、成膜性向上、膜の

ピンホール防止等のため適切な樹脂や添加剤を使用しても良い。使用の可能な樹脂としては、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン、ポリスルフォン、ポリメチルメタクリレート、ポリメチルアクリレート、セルロース等の絶縁性樹脂およびそれらの共重合体、ポリーNーピニルカルパゾール、ポリシラン等の光導電性樹脂、ポリチオフェン、ポリピロール等の導電性樹脂を挙げられる。また、添加剤としては、酸化防止剤、紫外線吸収剤、可塑剤等を挙げられる。

【0038】以上のように、有機EL案子の発光層に本発明の化合物を用いることにより、低い印加電圧で実用上充分な発光輝度が得られるため、発光効率が高く、劣化しずらいため寿命も長く、さらには耐熱性にも優れた有機EL案子を得ることができる。

【0039】本発明の有機EL素子は、壁掛けテレビのフラットパネルディスプレイ等の平面発光体、複写機、プリンター、液晶ディスプレイのバックライト又は計器類等の光源、表示板、標識灯等に利用できる。本発明の材料は、有機EL素子だけでなく、電子写真感光体、光 20電変換素子、太陽電池、イメージセンサー等の分野においても使用できる。

【0040】本発明の有機素子用材料の製造方法で使用する一般式〔6〕で示される1級アミンとしては、メチルアミン、エチルアミン、n-プロピルアミン、イソブ ロビルアミン、n-プチルアミン、イソブチルアミン、\*

\*secープチルアミン、tertープチルアミン、nー アミルアミン、イソアミルアミン、tert-アミルア ミン、シクロヘキシルアミン、n-ヘキシルアミン、ヘ プチルアミン、2-アミノヘプタン、3-アミノヘプタ ン、オクチルアミン、ノニルアミン、デシルアミン、ウ ンデシルアミン、ドデシルアミン、トリデシルアミン、 1-テトラデシルアミン、ペンタデシルアミン、1-ヘ キサデシルアミン、オクタデシルアミン等の1級アルキ ルアミン類: エチレンジアミン、1, 2-ジアミノプロ 10 パン、1、3-ジアミノプロパン、1、4-ジアミノブ タン等の1級アルキルジアミン類:アニリン、ローフル オロアニリン、m-フルオロアニリン、p-フルオロア ニリン、oートルイジン、血ートルイジン、p-トルイ ジン、ローアニシジン、mーアニシジン、ローアニシジ ン、1-ナフチルアミン、2-ナフチルアミン、1-ア ミノアントラセン、2-アミノアントラセン、2-アミ ノビフェニル、4ーアミノビフェニル、9ーアミノフェ ナントレン、2-トリフルオロメチルトルイジン、3-トリフルオロメチルトルイジン、4-トリフルオロメチ ルトルイジン等のアリールアミン類:o-フェニレンジ アミン、m-フェニレンジアミン、p-フェニレンジア ミン、フルオレンジアミン、1,8-ナフタレンジアミ ン等のアリールジアミン類;

[0041] [化22]

等が挙げられる。

【0042】一般式〔6〕で示される2級アミンとして

は、 【化23】

#### 等が挙げられる。

【0043】一般式〔7〕で示されるアリールハライド としては特に限定するものではないが、Arとしては、 通常炭素数1~18のアルキル基又は炭素数6~22の 置換もしくは無置換のアリール基が用いられ、芳香族環 に置換基を有していてもよい。また本発明においてアリ ール基とは、縮合環式炭化水素を含有するものである。 【0044】アリールハライドの具体例としては、ブロ モベンゼン、oープロモアニソール、mープロモアニソ ール、p-プロモアニソール、o-プロモトルエン、m ェノール、ローブロモフェノール、ローブロモフェノー ル、2-プロモベンソトリフロリド、3-プロモベンゾ トリロオリド、4ープロモベンソトリフロリド、1ープ ロモー2, 4ージメトキシベンゼン、1ープロモー2, 5-ジメトキシベンゼン、2-プロモフェネチルアルコ ール、3 - プロモフェネチルアルコール、4 - プロモフ ェネチルアルコール、5ープロモー1,2,4ートリメ チルベンゼン、2ープロモーmーキシレン、2ープロモ -p-キシレン、3-プロモ-o-キシレン、4-プロ モー $\sigma$ ーキシレン、4ープロモーmーキシレン、5ープ 50 ロローmーキシレン、5ークロローmーキシレン、1ー

30 ロモーmーキシレン、1ープロモー3ー(トリフルオロ メトキシ) ベンゼン、1ープロモー4ー (トリフルオロ メトキシ) ベンゼン、2-ブロモビフェニル、3-ブロ モビフェニル、4-プロモビフェニル、4-プロモー 1, 2-(メチレンジオキシ)ベンゼン、1-ブロモナ フタレン、2-プロモナフタレン、1-プロモ-2-メ チルナフタレン、1-プロモー4-メチルナフタレン等 のアリールプロミド類:クロロベンセン、0-クロロア ニソール、mークロロアニソール、pークロロアニソー ル、o-クロロトルエン、m-クロロトルエン、p-ク ープロモトルエン、pープロモトルエン、οープロモフ 40 ロロトルエン、οークロロフェノール、mークロロフェ ノール、p ークロロフェノール、2 ークロロベンゾトリ フロリド、3ークロロベンゾトリフロリド、4ークロロ ベンゾトリフロリド、1-クロロ-2, 4-ジメトキシ ベンゼン、1-クロロ-2,5-ジメトキシベンゼン、 2-クロロフェネチルアルコール、3-クロロフェネチ ルアルコール、4-クロロフェネチルアルコール、5-クロロー1, 2, 4-トリメチルベンゼン、2-クロロ -m-キシレン、2-クロロ-p-キシレン、3-クロ ローローキシレン、4ークロローローキシレン、4ーク

クロロー3-(トリフルオロメトキシ)ベンゼン、1-クロロー4ー (トリフルオロメトキシ) ベンゼン、2ー・ クロロピフェニル、3ークロロピフェニル、4ークロロ ピフェニル、1-クロロナフタレン、2-クロロナフタ . レン、1-クロロ-2-メチルナフタレン、1-クロロ -4-メチルナフタレン等のアリールクロリド類: ヨー ドベンゼン、o-ヨードアニソール、m-ヨードアニソ ール、p-ヨードアニソール、o-ヨードトルエン、m ーヨードトルエン、pーヨードトルエン、oーヨードフ ェノール、m-ヨードフェノール、p -ヨードフェノー 10 ル、2-ヨードベンゾトリフロリド、3-ヨードベンゾ トリフロリド、4-ヨードベンソトリフロリド、1-ヨ ードー2, 4ージメトキシベンゼン、1ーヨードー2, ·5ージメトキシベンゼン、2ーヨードフェネチルアルコ ール、3-ヨードフェネチルアルコール、4-ヨードフ ェネチルアルコール、5-ヨード-1,2,4-トリメ チルベンゼン、2-ヨード-m-キシレン、2-ヨード -p-キシレン、3-ヨード-o-キシレン、4-ヨー ド-o-キシレン、4-ヨード-m-キシレン、5-ヨ ードーエーキシレン、1-ヨード-3-(トリフルオロ 20 メトキシ) ベンゼン、1-ヨード-4-(トリフルオロ メトキシ) ベンゼン、2-ヨードピフェニル、3-ヨー ドビフェニル、4-ヨードビフェニル、1-ヨードナフ タレン、2-ヨードナフタレン、1-ヨード-2-メチ ルナフタレン、1-ヨード-4-メチルナフタレン等の\*

\*アリールアイオダイド類;フルオロベンゼン、o-フル オロアニソール、m-フルオロアニソール、p-フルオ ロアニソール、o-フルオロトルエン、m-フルオロト ルエン、p-フルオロトルエン、o-フルオロフェノー ル、m-フルオロフェノール、p-フルオロフェノー ル、2-フルオロベンゾトリフロリド、3-フルオロベ ンソトリフロリド、4-フルオロベンソトリフロリド、 1-フルオロ-2、4-ジメトキシベンゼン、1-フル オロー2, 5ージメトキシベンゼン、2ーフルオロフェ ネチルアルコール、3-フルオロフェネチルアルコー ル、4-フルオロフェネチルアルコール、5-フルオロ -1, 2, 4-トリメチルベンゼン、2-フルオロ-m ーキシレン、2-フルオロ-p-キシレン、3-フルオ ローローキシレン、4ーフルオローローキシレン、4ー フルオローmーキシレン、5-フルオローmーキシレ ン、1-フルオロー3-(トリフルオロメトキシ)ペン ゼン、1-フルオロー4-(トリフルオロメトキシ)べ ンゼン、2-フルオロピフェニル、3-フルオロビフェ ニル、4-フルオロピフェニル、4-フルオロ-1、2 - (メチレンジオキシ) ベンゼン、1-フルオロナフタ レン、2-フルオロナフタレン、1-フルオロ-2-ヌ チルナフタレン、1-フルオロ-4-ヌチルナフタレン 等のアリールフロリド類等:

[0045][化24]

# が挙げられる。

【0046】また、本発明の目的を逸脱しない限りにお いて、1,2-ジプロモベンゼン、1,3-ジプロモベイ ンゼン、1,4-ジプロモベンゼン、9,10-ジプロ モアントラセン、9、10-ジクロロアントラセン、 4, 4' -ジプロモビフェニル、4, 4' -ジクロロジ

- 2 - フルオロベンゼン、1 - ブロモ - 3 - フルオロベ ンゼン、1-プロモー4-フルオロベンゼン。2-ブロ モクロロベンゼン、3-プロモクロロベンゼン、4-プ ロモクロロベンゼン、2-プロモ-5-クロロトルエ ン、3-プロモー4-クロロベンソトリフロリド、5-プロモー2ークロロベンゾトリフロリド、1ープロモー フェニル、4,4'ージヨードピフェニル、1ープロモ 50 2,3ージクロロベンゼン、1ープロモー2,6ージク

ロロベンゼン、1-プロモー3, 5-ジクロロベンゼン、2-プロモー4-フルオロトルエン、2-プロモー5-フルオロトルエン、3-プロモー4-フルオロトルエン、4-プロモ+2-フルオロトルエン、4-プロモ\*

\*-3-フルオロトルエン、トリス (4-プロモフェニル) アミン、1、3、5-トリプロモベンゼン、 【0047】 【化25】

等のハロゲン原子を2つ以上、好ましくは2~3個有するアリールハライドも使用することができる。

【0048】本発明の有機素子用材料の製造方法においてアリールハライドの添加方法は、特に限定するものではなく、例えば、反応開始前に1級アミンと同時に2種類の異なるアリールハライドを添加してれらを反応させてもよいし、まず1級アミンと一方のアリールハライドを反応させた後、生成した2級アミンに他方のアリールハライドを添加してれらを反応させてもよい。3級アリールアミンをより高選択的に製造できることから、後者の逐次的に異なるアリールハライドを添加する方法が好ましい。

【0049】アリールハライドの添加量は特に制限されるものではないが、1級アミンと同時に2種類の異なるアリールハライドを添加する場合には、1級アミン1モルに対して、それぞれ0.5モル倍~10モル倍の範囲が適当であり、経済性及び未反応のアリールハライドの分離等、後処理を簡便とするため、好ましくは1級アミン1モルに対してそれぞれ0.7モル倍~5モル倍である。また逐次的に異なるアリールハライドは、1級アミンのアミノ基1つに対して、0.5~1.5倍モルの範囲で反応系に添加すればよいが、目的とする3級アリールアミンの選択率を向上させるという観点から、より好ましくは、該1級アミンのアミノ基1つに対して0.9モル~1.1倍モルの範囲で反応系に添加すればよい。

【0050】また、2級アミン製造後に添加されるアリールハライドは、原料とした1級アミンのアミノ基1つに対して0.1~10モル倍添加すればよいが、反応終 50

了後の未反応のアリールハライド及び未反応の2級アミンの分離操作が煩雑となることから好ましくは、1級アミンのアミノ基1つに対して0.9~5倍モル添加すればよい。

【0051】本発明で触媒成分として使用するパラジウ ム化合物としては、パラジウム化合物であれば特に制限 するものではなく、例えば、ヘキサクロロバラジウム (IV)酸ナトリウム四水和物、ヘキサクロロバラジウム (IV)酸カリウム等の4価のパラジウム化合物類;塩化 バラジウム(II)、臭化バラジウム(II)、酢酸バラジ ウム(II)、パラジウムアセチルアセトナート(II)、 ジクロロビス (ベンゾニトリル) パラジウム (II)、ジ クロロビス (アセトニトリル) パラジウム (II)、ジク ロロ (ビス (ジフェニルホスフィノ) エタン) パラジウ ム(II)、ジクロロビス(トリフェニルホスフィン)バ **ラジウム (II)、ジクロロテトラアンミンパラジウム** (II)、ジクロロ(シクロオクター1,5-ジェン)パ ラジウム (Π)、ハラジウムトリフルオロアセテート (II) 等の2価パラジウム化合物類:トリス (ジベンジ リデンアセトン) ニパラジウム (0) (Pd2(db a),)、トリス(ジベンジリデンアセトン) ニパラジウ ムクロロホルム錯体(0)、テトラキス(トリフェニル ホスフィン) パラシウム (0)、ピス (ピス (シフェニ ルホスフィノ) エタン) パラジウム(0) 等の0 価パラ ジウム化合物等が挙げられる。

【0052】本発明の製造方法において、バラジウム化合物の使用量は、特に限定するものではないが、1級アミン1モルに対し、バラジウム換算で0、00001~20、0モル%である。バラジウムが上記範囲内であれ

は、高い選択率で3級アリールアミンが合成できるが、 高価なパラジウム化合物を使用することから、より好ま しくは、該1級アミン1モルに対し、パラジウム換算で 0.001~5.0モル%である。

【0053】本発明の製造方法において、触媒成分とし て使用されるトリアルキルホスフィン化合物としては、 特に限定するものではなく、例えばトリエチルホスフィ ン、トリシクロヘキシルホスフィン、トリイソプロビル ホスフィン、トリーnープチルホスフィン、トリイソプ **チルホスフィン、トリーSec-ブチルホスフィン、ト** リーtert-ブチルホスフィン等が挙げられ、高い反 応活性を有することから好ましくはトリーtert-ブ チルホスフィンである。トリアリールホスフィン化合物 としては、特に限定するものではなく、例えばトリフェ ニルホスフィン、ベンジルジフェニルホスフィン、トリ トリルホスフィン (P (Tol);)、トリーoートリイ ルホスフィン、トリーロートリイルホスフィン、トリー pートリイルホスフィンが挙げられ、好ましくはトリフ ェニルホスフィン、トリーロートリイルホスフィンであ る。ジホスフィン化合物としては、特に限定するもので 20 はなく、例えばビス (ジメチルホスフィノ) メタン、ビ ス (ジメチルホスフィノ) エタン、ビス (ジシクロヘキ シルホスフィノ) メタン、ピス (ジシクロヘキシルホス フィノ) エタン、ピス (ジフェニルホスフィノ) エタ ン、1、3-ビス(ジフェニルホスフィノ)プロバン、 1, 4-ビス (ジフェニルホスフィノ) ブタン、ビス (ジフェニルホスフィノ) フェロセン、(R) -2, 2'-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1'-ビナ フチル ((R) - BINAP) (S) - 2 2' - Uス(ジフェニルホスフィノ)-1,1'-ピナフチル ((S)-BINAP)、2、2'-ビス(ジフェニル ホスフィノ) -1, 1'-ビナフチル((±)-BIN AP)、2S, 3S-ピス(ジフェニルホスフィノ) ブ タン((S, S)-CHIRAPHOS)、2R, 3R -ビス (ジフェニルホスフィノ) ブタン ((R, R) -CHIRAPHOS)、2、3-ビス(ジフェニルホス フィノ) ブタン ((t) - CHIRAPHOS)、

-ジメチルー(S)-1-((R)-1'、2-ビス (ジフェニルホスフィノ) フェロセニル) エチルアミン ((S), (R) - BPPFA)、N, N' -ジメチル - (R)-1- ((S)-1'、2-ピス(ジフェニル ホスフィノ) フェロセニル) エチルアミン ((R). (S) - BPPFA)、N, N' -ジメチル-1-〔1'、2-ピス(ジフェニルホスフィノ)フェロセニ ル) エチルアミン ((t)-BPPFA) が挙げられ、 好ましくはピス (ジフェニルホスフィノ) エタン、1. 10 3-ピス (ジフェニルホスフィノ) プロパン、ピス (ジ フェニルホスフィノ) フェロセン、BINAPであり、 BINAPは光学活性体でもラセミ体でも良い。 【0054】トリアルキルホスフィン化合物、トリフェ ニルホスフィン化合物又はジホスフィン化合物の使用量 は、パラジウム化合物に対して0.01~10000倍 モル使用すればよい。使用量がこの範囲であればアリー ルアミンの選択率に変化はないが、高価なホスフィン化 合物を使用することから、より好ましくはパラジウム化 合物に対して0.1~10倍モルである。

【0055】本発明の製造方法では、触媒成分としてバラジウム化合物とホスフィン化合物が必須であり、両者を組み合わせて触媒として反応系に加える。添加方法は、反応系にそれぞれ単独に加えても、予め錯体の形に調製して添加してもよい。

【0056】本反応で使用できる塩基は、ナトリウム、カリウムの炭酸塩やアルカリ金属アルコキシド等の無機塩基及び3級アミン等の有機塩基から選択すればよく、特に制限するものではないが、好ましくは、例えばナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウムメトキシド、ナトリウムーもertーブトキシド、カリウムーもertーブトキシド、セシウムカードネート(Cs, CO, )等のようなアルカリ金属アルコキシドであって、それらは反応場にそのまま加えても、またアルカリ金属、水素化アルカリ金属及び水酸化アルカリ金属とアルコールからその場で調製して反応場に供してもよい。

【0057】使用する塩基の量は、特に制限されるものではないが、反応に添加する2種類の異なるアリールハライドのハロゲン原子に対して、0.5倍モル以上使用することが好ましい。塩基の量が、0.5倍モル未満では、反応活性が低下しアリールアミンの収率の低下を招くため好ましくない。塩基の量は大過剰に加えてもアリールアミンの収率に変化はないが、反応終了後の後処理操作が煩雑になることから、より好ましくは1.0~5倍モル以下である。

【0058】本発明の製造方法における反応は、通常は 不活性溶媒下に実施され、そのような不活性溶媒として は、本反応を著しく阻害しない溶媒であればよく、例え 50 はベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素溶

媒:ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサ ン等のエーテル溶媒;アセトニトリル、ジメチルホルム アミド、ジメチルスルホキシド、ヘキサメチルホスホト リアミド等を例示することができる。より好ましくは、 ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素溶媒

【0059】本発明の製造方法は、常圧下、窒素、アル ゴン等の不活性ガス雰囲気下で実施することが好ましい が、たとえ加圧条件であっても実施することができる。 本発明の製造方法は、反応温度20°C~300°C、より 10 【0063】中間体Dの合成 好ましくは50℃~200℃の範囲、反応時間は、数分 ~72時間の範囲から選択すればよい。

#### [0060]

【実施例】以下、本発明を合成例及び実施例に基づいて さらに詳細に説明する。

### 合成例 1 (化合物 a )

### 中間体Aの合成

アルゴン気流下500ミリリットル三口フラスコ中に、 p-プロモベンズアルデヒド 50g(0.27mo 1)、ベンジルホスホン酸ジエチルエステル 50g (0.22mmol)、ジメチルスルホキシド(DMS O) 200ミリリットルを仕込んだ。次にt-ブトキ シカリウム 30g(0.27mol)を少しずつ添加 し、室温で一晩攪拌し反応させた。反応終了後、反応液 を、水500ミリリットル中に注入し、酢酸エチルで抽 出した。硫酸マグネシウムで乾燥後、ロータリーエバボ レーターで減圧濃縮した。得られた粗結晶を酢酸エチル 100ミミリリットルで再結晶させ、中間体A 46 g (収率81%)を得た。

#### 【0061】中間体Bの合成

アルゴン気流下、冷却管付き300ミリリットル三口フ ラスコ中に、中間体A10g(38mmo1)、アニリ ン 14g(150mmol)、トリス(ジベンジリデ ンアセトン) ジバラジウム 0.53g(1.5mol %)、トリーoートルイルホスフィン 0.35g(3 mo1%)、t-ブトキシナトリウム7.4g(77m o1)及び乾燥トルエン 100ミミリリットルを加え た後、100℃で一晩加熱攪拌し反応させた。反応終了 後、析出した結晶を濾取し、メタノール 100ミミリ リットルで洗浄した。得られた粗結晶を酢酸エチル50 40 ミミリリットルで再結晶させ、中間体B 7.7g(収

率73%)を得た。

#### 【0062】中間体Cの合成

冷却管付き100ミリリットルナスフラスコ中に、4-プロモベンジルプロミド 12.5g(50mmo 1)、亜リン酸トリエチル12.5(75mmo1)を 加え、100℃で7時間加熱攪拌し反応させた。反応終 了後、過剰な亜リン酸トリエチルを減圧蒸留で留去し、 中間体C 15.4gを得た。中間体Cは、これ以上精 製せずに次の反応に用いた。

アルゴン気流下、300ミリリットル三口フラスコ中 に、p-プロモベンズアルデヒド 9.2g(50mm ol)、中間体C 15.4g(50mmol)、DM SO 100ミリリットルを仕込んだ。次にセープトキ シカリウム 6.7g (60mmol)を少しずつ添加 し、室温で一晩攪拌し反応させた。反応終了後、反応液 を、水200ミリリットル中に注入し、酢酸エチルで抽 出した。硫酸マグネシウムで乾燥後、ロータリーエバボ レーターで減圧濃縮した。得られた粗結晶をメタノール 100ミミリリットルで洗浄し、中間体D 13g (収率77%)を得た。

#### 【0064】化合物aの合成

アルゴン気流下、冷却管付き200ミリリットル三口フ ラスコ中に、中間体B4g(15mmol)、中間体D 2g(6mmol)、トリス(ジベンジリデンアセト ン) ジパラジウム 0.16g(3mol%)、(S) -BINAPO. 22g (6mo1%)、tープトキシ ナトリウム 1.4g(15mmol)及び乾燥トルエ ン 50ミミリリットルを加えた後、100°Cで一晩加 30 熱攪拌し反応させた。反応終了後、析出した結晶を濾取 してメタノールで洗浄し、60°Cで一晩加熱乾燥した。 得られた粗結晶をカラムクロマトグラフ(シリカゲル、 ヘキサン/トルエン=8/2)で精製し、黄色粉末 1. 4gを得た。この粉末は、NMR、IR及びFD-MS(フィールドディソプーションマススペクトル)の 測定により、化合物 a と同定された(収率32%:1H има (90MHz) соδ 7, 0~7, 4 ppm (4. 2H、m)))。化合物aのNMRチャートを図1に示 す。化合物aの反応式を以下に示す。

[0065]

[126]

媒; ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサ ン等のエーテル溶媒:アセトニトリル、ジメチルホルム` アミド、ジメチルスルホキシド、ヘキサメチルホスホト リアミド等を例示することができる。より好ましくは、 ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素溶媒

【0059】本発明の製造方法は、常圧下、窒素、アル ゴン等の不活性ガス雰囲気下で実施することが好ましい が、たとえ加圧条件であっても実施することができる。 本発明の製造方法は、反応温度20℃~300℃、より 10 好ましくは50℃~200℃の範囲、反応時間は、数分 ~72時間の範囲から選択すればよい。

 $\{00001$ 

【実施例】以下、本発明を合成例及び実施例に基づいて さらに詳細に説明する。

合成例1(化合物a)

中間体A の合成

アルゴン気流下500ミリリットル三口フラスコ中に、 p-プロモベンズアルデヒド 50g(0.27mo 1)、ベンジルホスホン酸ジエチルエステル 50g (0.22mmol)、ジメチルスルホキシド (DMS O) 200ミリリットルを仕込んだ。次にt-ブトキ シカリウム 30g(0.27mol)を少しずつ添加 し、室温で一晩攪拌し反応させた。反応終了後、反応液 を、水500ミリリットル中に注入し、酢酸エチルで抽 出した。硫酸マグネシウムで乾燥後、ロータリーエバボ レーターで減圧濃縮した。得られた粗結晶を酢酸エチル 100ミミリリットルで再結晶させ、中間体A 46 g (収率81%)を得た。

【0061】中間体Bの合成

アルゴン気流下、冷却管付き300ミリリットル三口フ ラスコ中に、中間体A10g(38mmol)、アニリ ン 14g(150mmol)、トリス(ジベンジリデ ンアセトン) ジパラジウム 0.53g(1.5mol %)、トリーoートルイルホスフィン 0.35g(3 mo1%)、t-ブトキシナトリウム7.4g(77m 01)及び乾燥トルエン 100ミミリリットルを加え た後、100℃で一晩加熱攪拌し反応させた。反応終了 後、析出した結晶を濾取し、メタノール 100ミミリ リットルで洗浄した。得られた粗結晶を酢酸エチル50 40 【0065】 ミミリリットルで再結晶させ、中間体B 7.7g(収

率73%)を得た。

【0062】中間体Cの合成

冷却管付き100ミリリットルナスフラスコ中に、4-プロモベンジルプロミド 12.5g(50mmo 1)、亜リン酸トリエチル12、5 (75mmo1)を 加え、100℃で7時間加熱攪拌し反応させた。反応終 了後、過剰な亜リン酸トリエチルを減圧蒸留で留去し、 中間体C 15.4gを得た。中間体Cは、これ以上精 製せずに次の反応に用いた。

【0063】中間体Dの合成・

アルゴン気流下、300ミリリットル三口フラスコ中 に、p-ブロモベンズアルデヒド 9.2g(50mm ol)、中間体C 15.4g(50mmol)、DM SO 100ミリリットルを仕込んだ。次に tープトキ シカリウム 6,7g(60mmol)を少しずつ添加 し、室温で一晩攪拌し反応させた。反応終了後、反応液 を、水200ミリリットル中に注入し、酢酸エチルで抽 出した。硫酸マグネシウムで乾燥後、ロータリーエバボ レーターで減圧濃縮した。得られた粗結晶をメタノール 100ミミリリットルで洗浄し、中間体D 13g (収率77%)を得た。

【0064】化合物 a の合成

アルゴン気流下、冷却管付き200ミリリットル三口フ ラスコ中に、中間体B4g(15mmol)、中間体D 2g(6mmo1)、トリス(ジベンジリデンアセト ン) ジパラジウム 0.16g (3mol%)、(S) -BINAPO. 22g (6mol%)、t-ブトキシ ナトリウム 1.4g(15mmol)及び乾燥トルエ ン 50ミミリリットルを加えた後、100°Cで一晩加 30 熱攪拌し反応させた。反応終了後、析出した結晶を違取 してメタノールで洗浄し、60℃で一晩加熱乾燥した。 得られた粗結晶をカラムクロマトグラフ(シリカゲル、 ヘキサン/トルエン=8/2)で精製し、黄色粉末 1. 4gを得た。この粉末は、NMR、IR及びFD-MS (フィールドディソプーションマススペクトル) の 測定により、化合物 a と同定された(収率32%:1 H мыя (90MHz) でのる 7.0~7,4 pom (4 2H、m)))。化合物aのNMRチャートを図1に示 す。化合物aの反応式を以下に示す。

【化26】

化合物 a

# 【0066】合成例2(化合物b) 中間体Eの合成

アルゴン気流下、300ミリリットル三口フラスコ中 に、p-トルアルデヒド6g(50mmo1)、中間体 20 C 15. 4g (50mmol), DMSO100ミリ リットルを仕込んだ。次に t - ブトキシカリウム 6. 7g(60mmol)を少しずつ添加し、室温で一晩攪 拌し反応させた。 反応終了後、 反応液を水200ミリリ ットル中に注入し、酢酸エチルで抽出した。硫酸マグネ シウムで乾燥後、ロータリーエバポレーターで減圧濃縮 した。得られた粗結晶をメタノール 100ミミリリッ トルで洗浄し、中間体E 9.2g(収率67%)を得 100.

#### 【0067】化合物bの合成

アルゴン気流下、冷却管付き200ミリリットル三口フ ラスコ中に、中間体E4g(15mmo1)、N, N' ージフェニルベンジジン 2g (6mmol)、トリス (ジベンジリデンアセトン) ジパラジウム 0.16g (3mol%), (S)-BINAP 0.22g(6 mo1%)、tーブトキシナトリウム1.4g(15m mo1)及び乾燥トルエン 50ミミリリットルを加え た後、100℃で一晩加熱攪拌し反応させた。反応終了 後、析出した結晶を濾取してメタノールで洗浄し、60 \*Cで一晩加熱乾燥した。得られた粗結晶をカラムクロマ 40 トグラフ (シリカゲル、ヘキサン/トルエン=8/2) で精製し、黄色粉末2.5gを得た。この粉末は、NM R、IR及びFD-MSの測定により、化合物bと同定 された (収率58%: 1 H<sub>NNR</sub> (90MHz) でのδ 7.  $0 \sim 7$ . 4 ppm (40H, m),  $\delta$  2. 34 p pm(6H、s)))。化合物bのNMRチャートを図 2に示す。化合物bの反応式を以下に示す。

[0068]

[化27]

30

\*【0069】合成例3(化合物c) 化合物 c の合成

アルゴン気流下、冷却管付き200ミリリットル三口フ ラスコ中に、中間体B4g (15mmo1)、1,4-ジプロモナフタレン 1.7g(8mmoi)、トリス (ジベンジリデンアセトン) ジバラジウム 0.16g (3mol%), (S)-BINAP 0.22g(6 mo1%)、t-プトキシナトリウム1, 4g(15m mol) 及び乾燥トルエン 50ミミリリットルを加え 10 た後、100℃で一晩加熱攪拌し反応させた。反応終了 後、析出した結晶を適取してメタノールで洗浄し、60 \*Cで一晩加熱乾燥した。得られた粗結晶をカラムクロマ トグラフ (シリカゲル、ヘキサン/トルエン=8/2) で精製し、黄色粉末2.0gを得た。この粉末は、NM R、IR及びFD-MSの測定により、化合物 c と同定 された (収率50%: H<sub>NNR</sub> (90MHz) でのδ 7.0~7.4ppm(68H、m))。化合物cの反

[0070]

応式を以下に示す。

20 【化28】

30

化合物c

₿

Pd: (dba); BINAP

【0071】合成例4(化合物d)

化合物 d の合成

アルゴン気流下、冷却管付き200ミリリットル三口フ ラスコ中に、中間体B4g(15mmol)、9,10 50 7g(6mol%)、t-ブトキシナトリウム 1.4

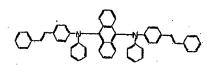
ージプロモアントラセン 2g (6mmol)、トリス (ジベンジリデンアセトン) ジパラジウム 0. 16g (3mol%)、トリーtープチルホスフィン 0.0

g(15mmo1)及び乾燥トルエン 50ミミリリットルを加えた後、100℃で一晩加熱攪拌し反応させた。反応終了後、析出した結晶を適取してメタノールで洗浄し、60℃で一晩加熱乾燥した。得られた粗結晶をカラムクロマトグラフ(シリカゲル、ヘキサン/トルエン=8/2)で精製し、黄色粉末 1.9gを得た。と\*

化合物 d

Br Br Br Pd, (dba), P(tBu), NaOtBu PhMe

\*の粉末は、NMR、IR及びFD-MSの測定により、 化合物dと同定された(収率44%: 1 H<sub>HHR</sub> (90M Hz)での6 7.0~7.4ppm(40H、 m)))。化合物dの反応式を以下に示す。 【0072】 【化29】



化合物d

【0073】合成例5(化合物e) 中間体Eの合成

アルゴン気流下、300ミリリットル三口フラスコ中に、trans-4-スチルベンアルデヒド 10.4 g(50mmol)、中間体C 15.4g(50mmol)、DMSO 100ミリリットルを仕込んだ。次 20にtーブトキシカリウム 6.7g(60mmol)を少しずつ添加し、室温で一晩攪拌し反応させた。反応終了後、反応液を水200ミリリットル中に注入し、酢酸エチルで抽出した。硫酸マグネシウムで乾燥後、ロータリーエパポレーターで減圧濃縮した。得られた粗結晶をメタノール 100ミミリリットルで洗浄し、中間体下12.5g(収率69%)を得た。

【0074】化合物eの合成

アルゴン気流下、冷却管付き200ミリリットル三口フ ラスコ中に、中間体F5.4g(15mmo1)、N.  $N' - \Im 7 = 2 \pi (6 mm o 1)$ , リス (ジベンジリデンアセトン) ジバラジウム 0.1 6g(3mo1%)、トリーoートルイルホスフィン 0. 11g(6mo1%)、t-ブトキシナトリウム 1. 4g(15mmol)及び乾燥トルエン 50ミミ リリットルを加えた後、100°Cで一晩加熱攪拌し反応 させた。反応終了後、析出した結晶を遮取してメタノー ルで洗浄し、60°Cで一晩加熱乾燥した。得られた粗結 晶をカラムクロマトグラフ(シリカゲル、ヘキサン/ト ルエン=6/4)で精製し、黄色粉末 1.0gを得 た。この粉末は、NMR、IR及びFD-MSの測定に より、化合物 e と同定された (収率19%: 1 H <sub>3NR</sub> (90MHz) でのδ7. 0~7. 5ppm (52 H、m))。化合物eのNMRチャートを図3に示す。 化合物eの反応式を以下に示す。

[0075] [化30]

\*【0076】化合物fの合成

アルゴン気流下、冷却管付き200ミリリットル三口フ ラスコ中に、中間体A7.8g(30mmo1)、4, 4' -ジアミノスチルベン 二酸化炭素 1,7g(6 шшо1)、トリス (ジベンジリデンアセトン) ジパラ ジウム 0.16g (3mo1%)、(S)-BINA P 0.22g(6mo1%)、t-プトキシナトリウ ム 9.6g(0.1mol)及び乾燥トルエン 50 ミミリリットルを加えた後、100°Cで一晩加熱攪拌し 10 反応させた。反応終了後、析出した結晶を適取してメタ ノールで洗浄し、60°Cで一晩加熱乾燥した。得られた 粗結晶をカラムクロマトグラフ (シリカゲル、ヘキサン /トルエン=6/4)で精製し、黄色粉末 2.0gを 得た。この粉末は、NMR、IR及びFD-MSの測定 により、化合物 f と同定された (収率36%: Hama (90MHz) τοδ 7.0~7.5ppm (54 H、m))。化合物fの反応式を以下に示す。 [0077]

【化311

20

30

化合物 f

Pd: (dba); BINAP NaOtBu PhMe

【0078】実施例1 洗浄したITO電極付きガラス板上に、正孔注入材とし

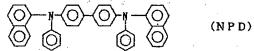
て下記化合物 (TPD74)を膜厚60nmに真空蒸着 50

した。 [(1:32]

(TPD74)

次に、正孔輸送材として下記化合物(NPD)を膜厚2 0ヵmに真空蒸着した。

【化33】



次に、発光材料としてスチルベン誘導体の4,4 ーピス(2,2ージフェニルビニル)ピフェニル(DPVBi)及び上記化合物(a)を、化合物(a)の割合が2重量%、膜厚40nmとなるように同時蒸着した。尚、化合物(a)は蛍光性のドーパント又は発光中心として機能する。次に、電子注入材として下記化合物(Alq)

(化34)

を膜厚20nmで蒸着し、さらにLiFを膜厚0.5nmで蒸着後アルミニウムを膜厚100nm蒸着し電極を形成して有機EL素子を得た。各層は10-6Torrの真空中で、基板温度室温の条件下で蒸着した。この素子の発光特性は、直流電圧6Vの印加電圧で発光輝度10 300(cd/m²)、発光効率は2.1(1m/W)であった。色度座標は(0.146,0.140)と純度の高い青色発光が可能となった。また、初期発光輝度200(cd/m²)で、定電流駆動したところ半減寿命は200時間と長寿命であった。これらの発光特性を表1に示す。尚、化合物aのエネルギーギャップは2.78eV、DPVBiは3.0eVであった。

#### 【0079】実施例2

ドーパント又は発光中心として、上記化合物りを使用した以外は実施例1と同様にして有機E L 素子を作製した。この素子の発光特性は、直流電圧6 Vの印加電圧で発光輝度110(cd/m²)、発光効率は1.3(1m/W)であった。色度座標は(0.152,0.163)と純度の高い青色発光が可能となった。また、初期発光輝度200(cd/m²)で、定電流駆動したところ半減寿命は1500時間と長寿命であった。これらの発光特性を表1に示す。尚、化合物りのエネルギーギャップは2.90eV、DPVBiは3.0eVであった。【0080】実施例3

ドーパント又は発光中心として、上記化合物cを使用し 50 たが、Alaの桃色発光しか得られなかった。また、初

た以外は実施例1と同様にして有機EL素子を作製した。との素子の発光特性は、直流電圧6Vの印加電圧で 発光輝度130(cd/m²)、発光効率は2.1(1m/W)であった。色度座標は(0.162,0,181)と純度の高い青色発光が可能となった。また、初期発光輝度200(cd/m²)で、定電流駆動したとろ半減寿命は2800時間と長寿命であった。これらの発光特性を表1に示す。尚、化合物でのエネルギーギャップは2.83eV、DPVBiは3.0eVであった。【0081】実施例4

ドーパント又は発光中心として、上記化合物 dを使用した以外は実施例 1 と同様にして有機 E L 素子を作製した。この素子の発光特性は、直流電圧 6 V の印加電圧で発光輝度 3 0 0 (cd/m²)、発光効率は4.6 (1m/W)で、高効率な緑色発光が可能となった。また、初期発光輝度 2 0 0 (cd/m²)で、定電流駆動したところ半減寿命は3 4 0 0 時間と長寿命であった。これらの発光特性を表1 に示す。尚、化合物 d のエネルギーギャップは2.78 e V、DP V Biは3.0 e V であった。

### 【0082】比較例1

ドーパント又は発光中心として下記化合物 (TPD)を 使用したことを除き、実施例1と同様にして有機EL素 子を作製した。

【化35】

この素子の発光特性は、直流電圧5Vの印加電圧で発光輝度60(cd/m²)、発光効率0.7(1m/W)と充分な性能が得られなかった。TPDは発光中心として機能せず、このためDPVTPからの発光が得られた。また、初期発光輝度200(cd/m²)で、定電流駆動したところ半減寿命は100時間と短かった。これらの発光特性を表1に示す。尚、TPDのエネルギーギャップは3.10eV、DPVBiは3.0eVであった。【0083】比較例2

ドーパント又は発光材料として上記化合物 a を、発光材料として上記化合物(A l q )を使用したことを除き、実施例1と同様にして有機E L 素子を作製した。この素子の発光特性は、直流電圧 6 V の印加電圧で発光輝度 2 10 (c d / m²)、発光効率1.3 (1 m / W)であったが、A l q の財免発光しか得られたかった。また、初

期発光輝度200 (cd/m³)で定電流駆動したところ 半減寿命は200時間と寿命が短かった。これらの発光 特性を表1に示す。化合物 a は発光中心として機能して いなかった。尚、化合物 a のエネルギーギャップは2. 95eV、Alqは2.7eVであった。

【0084】比較例3

ドーバント又は発光材料を使用せず、単独の発光材料と して上記化合物 c を使用じたことを除き、実施例1と同\* \*様にして有機EL素子を作製した。この素子の発光特性は、直流電圧6Vの印加電圧で発光輝度40(cd/m³)、発光効率0.9(1m/W)と充分な性能が得られなかった。また、初期発光輝度200(cd/m³)で定電流駆動したところ半減寿命は180時間と寿命が短かった。これらの発光特性を表1に示す。

[0.085]

【表1】

表 1

, ;		ドーパン ト又は 発光中心	発光材料	will (v)	発光輝度 (cd/m²)	<del>発光</del> 效率 (lm/Y)	発光色	半減寿命(時間)
1		7676176		(1)	(00,00)	(10/11)		(Millio)
実	1	化合物 a	DPVBi	6	100	. 2. 1	背	2000
施施	2	化合物b	DPVBi	6	110	1. 3	骨	1500
例	3	化合物 c	DPVBi	6	130	2. 1	背	2800
274	4	化合物d	DPVBi	6	300	4 6	緑	3400
比	1	TPD	DPVBi	5	6.0	0. 7	俼	100
較	2	化合物a	Alq	6	210	1. 3	緑	2 0 0
例	3	なし	化合物 c	6	4 0	0.9	膏	180

【0086】表1に示したように、ホスト材料に微量 (1~20重量%)の上記一般式〔1〕で示される化合物をドーパント又は発光中心として添加した実施例1~ 3の有機EL素子は、比較例1~3に比べ発光効率が高く、寿命も大幅に長かった。

[0087]

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明の上記一般式〔1〕で表される化合物からなる有機エレクトロルミネッセンス素子用材料又は〔1'〕で表される 30 新規化合物をドーパント又は発光中心として使用した有機エレクトロルミネッセンス素子は、低い印加電圧で実用上充分な発光輝度が得られ、発光効率が高く、長時間

使用しても性能が劣化しずらく寿命が長い。また、本発明の方法により有機素子用材料を製造すると、発光効率が高く、寿命が長く、高活性な有機エレクトロルミネッセンス素子用材料を、不純物が少なく高収率で製造することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

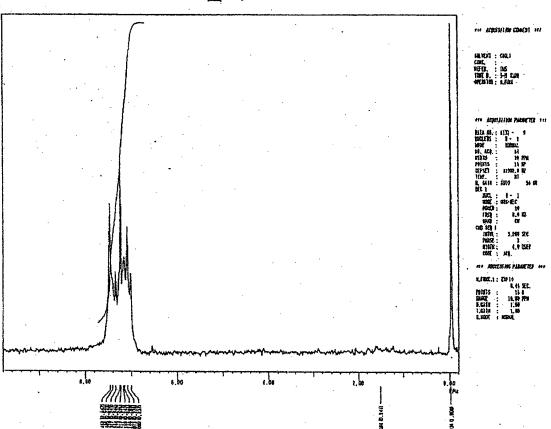
【図1】 本発明の製造方法で合成した化合物 a の H н チャートである。

【図2】 本発明の製造方法で合成した化合物bの H

【図3】 本発明の製造方法で合成した化合物 e の H H H F ヤートである。

【図1】

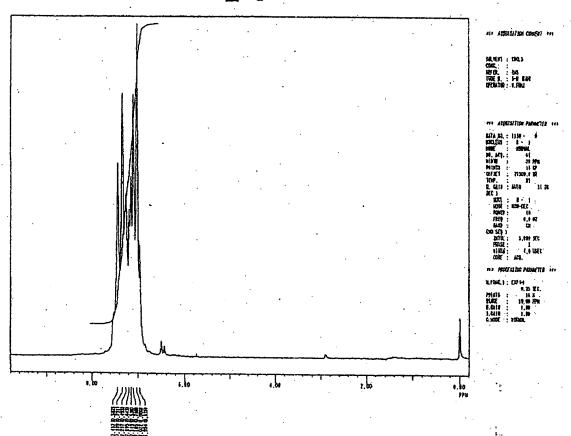




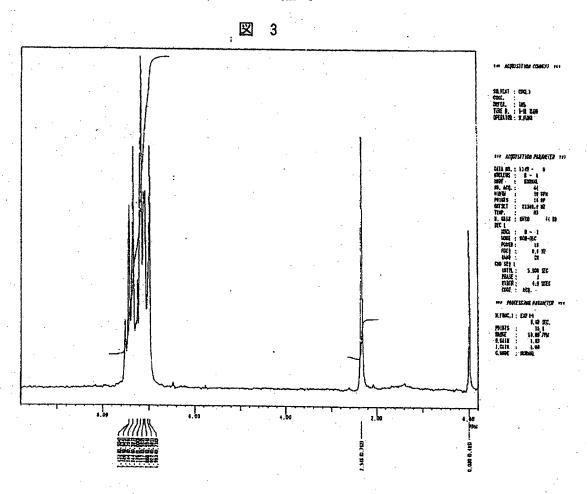
BEST AVAILABLE COPY

[図2]

図 2



【図3】



# BEST AVAILABLE COPY